

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

МАГНА ТМ 200-01

Назначение: Нанесение многокомпонентных и многослойных металлических или диэлектрических тонких пленок на подложки (пластины) методом магнетронного распыления.



Особенности:

- Индивидуальная и групповая обработка подложек на подложкодержателе в одном технологическом цикле: 60x48мм – 7 шт.; Ø 76мм – 4 шт.; Ø 100, 150, 200мм – 1 шт.;
- Мультикатодное МРУ с тремя мишенями Ø100мм;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Нагрев подложки до и во время нанесения покрытий;
- Нанесение из трех магнетронов одной пленки или последовательное нанесение двух-, трехслойных пленок с использованием заслонки;
- Безмасляная система откачки;
- Мощность потребления не более 16 кВт;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

